

### < 装置概要 >

172nmXeエキシマ真空紫外線ランプを装備したUV洗浄・表面改質装置です。

### < 特徴 >

エキシマ真空紫外線ランプにより、低圧水銀ランプの10倍以上の洗浄・改質が可能です。本装置は開発実験、および少量生産が可能です。

ローディング機構を装備しているため、ワークの交換時にランプユニットを開閉する必要はありません。

処理可能エリアは、230mm角以内です。

照射距離調整機構を装備し、照射距離の変更・調整が可能な構造です。

照射距離はパルスモーター駆動により、0.1mm単位での設定が可能です。

処理室用ガス供給部を装備しているため、清浄な雰囲気で、

また必要なガス雰囲気での処理が可能です。

処理室内を窒素ガスで置換し、オゾンレスでのUV処理も可能です。

操作は自動と手動の両方の設定が可能です。

エキシマランプの照射時間は設定可能で照射時間積算計を装備しています。

触媒式オゾン分解ユニットを内蔵し、環境基準以下に除害後、排気します。

寸法は、600(幅)600(奥行き)1100(高さ)、重量は約80kgです。  
最大8インチシリコンウエハー用として、FCS-8Rも有ります。

### < 用途 >

1. 高分子材料等の表面改質
2. 光学レンズの有機物洗浄 (密着性向上)
3. TABテープの有機物洗浄・ポリイミドの表面改質 (密着性向上)
4. 有機EL製造プロセスでのITO膜の有機物洗浄 (密着性向上・光輝度向上)
5. ガラス基板の有機物洗浄
6. シリコンウエハーの有機物洗浄

